大気・水質汚染防止と用水使用量低減

SOx、NOx、ばいじん、BOD等の排出量の削減や、 用水使用量の削減に取り組んでいます。

大気汚染物質(SOx, NOx、ばいじん)の 削減について

定期的な排出量測定と法規制順守

国内拠点では、大気汚染物質の法定基準値を順守するため、自 主基準値を設定し、定期的(年2回)に測定を行っています。海外 拠点では、法定基準値が設定されている場合は、定期的(年1回) に測定を行っています。いずれも法規制値を順守しています。

排出量の推移

2003年度以降、国内エレクトロニクス機器事業の大気汚染物 質排出量が大きく増加した理由は、山形カシオにおけるコジェネレ ーションシステムの導入および本格稼動したためです。

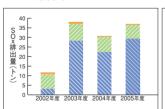
2005年度の実績

カシオマイクロニクス(青梅)では、冷温水発生器の燃料をA重 油から都市ガスに変更することで、SOxの排出量を2004年度に比 べて1.4トンから0.8トンに削減しました。

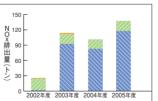
今後の取り組み

A重油から都市ガス、灯油、LPGなど大気汚染物質のより少な い燃料への代替を検討します。

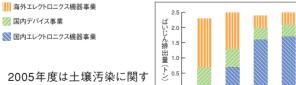
SOx 排出量



NOx 排出量



ばいじん排出量



- /// 国内デバイス事業 国内エレクトロニクス機器事業
- 2005年度は土壌汚染に関す る事象の発生はありませんでした。

用水使用量の 削減について

2005年度は、目標である2005年度までに国内生産拠点におけ る水使用量の生産高原単位を5%削減する(2000年度比)に対し

て、34%の増加となりました。

これは、分子となる水使用量が3.311千m3と2004年度に比べ て301千m3増加し、分母となる生産金額がTFT液晶の単価下落 より、小さくなったためです。

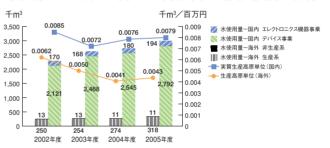
また、2005年度の循環水利用量は249千m3で、水使用量の 7.5%にあたります。

今後の取り組み

- ■国内生産拠点:2008年度までに実質生産高原単位で10%削減 (2000年度比)
- ■海外生産拠点:2008年度までに生産高原単位で5%削減(2004

を達成するために取り組んでいきます。

水使用量と実質生産高・生産高原単位の推移(国内・海外)



水域汚染物質(BOD)の 削減について

● 定期的な排出量測定と法規制順守

の増加とカシオタイの測定値を BOD 排出量

国内拠点では、水域汚染物質の法定基準値を順守するため、自 主基準値を設定し、定期的(年2回)に測定を行っています。海外 拠点では、法定基準値が設定されている場合は、定期的(年1回) に測定を行っています。いずれも法規制値を順守しています。

排出量の推移

2005年度のBOD値が2004年度に対して増加したのは、排水量

加えたことによります。また、デ バイス事業のBOD値が全体の BOD値の68%を占めています。

🧼 今後の取り組み

これからも法規制値を順守 すべく取り組んでいきます。

